

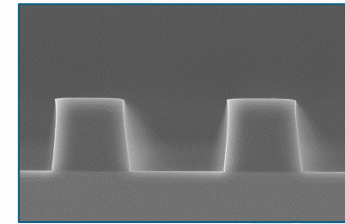
# Resist-Produktübersicht

Aus unserer Preisliste 2025 – Auf Kundenwunsch fertigen wir für Sie auch maßgeschneiderte Produkte passend zu Ihrem Produktionsprozess!

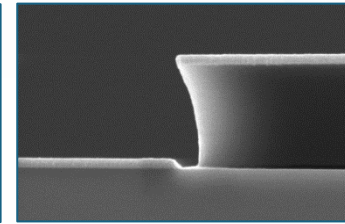
Anwendung		Produktname	Do [µm] / 4000 rpm
Positiv - Photoresists, i-line, g-line	Sprüh-Photoresists für verschiedene Anwendungen	AR-P 1210, 1220	[0,5 - 10]
	Photoresists zur Maskenherstellung, Feinteilungen, hochauflösend	AR-P 3110, 3120, 3170	1,0 ; 0,6 ; 0,1
	Photoresists hoher Schichtdicke, Mehrfachbeschichtung bis 100 µm	AR-P 3210, 3220, 3250	10 ; 10 ; 5
	Standard-Photoresists, große Prozessbreite, hochauflösend	AR-P 3510 (T), 3540 (T)	2,0 ; 1,4
	Photoresist für hohen Kontrast, höchstaflösend, sub-µm	AR-P 3740	1,4
	Photoresist für unterschrittene Strukturen (1-Lagen-lift-off)	AR-P 5350	1,0
	Thermostabiler Photoresist bis 300 °C	SX AR-P 3500/8	1,4
Sondersysteme	Schutzlack, 40 % KOH-ätzstabil	AR-PC 5040	2,8
	Schutzlack, Waferrückseitenschutz, 40% KOH-, 38% HF-resistent	SX AR-PC 5000/41	5
	Leitfähiger Schutzlack für E-Beamresists (außer Medusa 84 SiH)	<b>Electra 92:</b> AR-PC 5092.02	0,04
	<b>Neu:</b> Leitfähiger Schutzlack für E-Beamresists - <b>Allrounder</b> -	<b>Electra 94:</b> AR-PC 5094.02	0,04
	Bottomresist für 2-Lagen-Lift-off-Systeme (wahlweise mit positiv oder negativ arbeitendem Photoresist)	AR-BR 5640, 5480	1,0 ; 0,5
	Thermostrukturierbarer Resist, höchstaflösend mit NanoFrazor	<b>Phoenix 81:</b> PPA-Polymer für AR-P 8100	0,02 ... 0,2
Negativ - Photoresists	Sprüh-Photoresists für verschiedene Anwendungen	AR-N 2210, 2220	[0,5 - 10]
	Standard-Photoresist für i-line, g-line und lift-off, höchstempfindlich, hochauflösend	AR-N 4340	1,4
	Resists für i-, g-line, hohe Schichten, leicht removbar, Profile hoher Kantensteilheit, exzellente Auflösung, lift-off	<b>CAR 44:</b> AR-N 4400-50, 4400-25, 4400-10, 4400-05	50 ; 25 ; 10 ; 5 (1000 rpm)
	Resists für stabile Strukturen bis 100 µm, adäquat SU-8	<b>Atlas 46:</b> AR-N 4600-10	10 (1000 rpm)
	Thermostabiler Photoresist bis 300 °C für 1- und 2-Lagensysteme	SX AR-N 4340/7	1,4
Positiv - E-Beamresists	E-Beamresist mit Copolymer PMMA/MA 33%, höchstaflösend	AR-P 617	0,09 ... 1,75
	E-Beamresists mit PMMA 50K, 200K, 600K, 950K, höchstaflösend Chlorbenzen (1), Anisol (2), Ethyllactat (9)	AR-P 641-671, 632-672, AR-P 639-679	0,01 ... 1,87
	E-Beamresists, höchstaflösend, hochempfindlich, sehr plasmaätzresistent und prozessstabil	<b>CSAR 62:</b> AR-P 6200.04, 6200.09, 6200.13, 6200.18	0,08 ... 0,80
	E-Beamresist für hohe PMMA-Schichten bis 100 µm, auch Tief-UV	AR-P 6510.15	45 (200 rpm)
Negativ- E-Beamresists	Mix & match, ätzresistent, höchstaflösend, höchstempfindlich	AR-N 7520 neu	0,4 ; 0,2 ; 0,1
	Mix & match, ätzresistent, höchstaflösend, hochpräzise Kanten	AR-N 7520	0,4 ; 0,1
	<b>Neu:</b> E-Beamresists mit verbessertem HSQ-Polymer, sehr prozess- und lagerstabil, sehr ätzstabil und haftfest	<b>Medusa 84 SiH:</b> SX AR-N 8400.04, 8400.08, 8400.12, 8400.22	0,05 ; 0,10 ; 0,20 ; 0,40



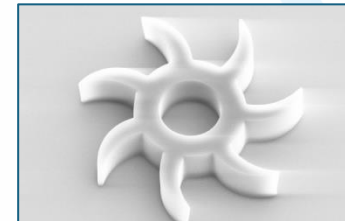
**Innovation  
Kreativität  
Kundenspezifische Lösungen**



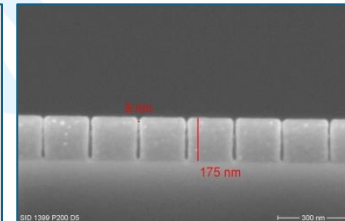
20 µm hohe Stege mit AR-P 3220



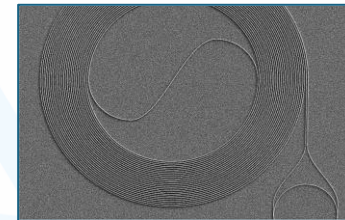
Lift-off-Strukturen mit AR-P 5350



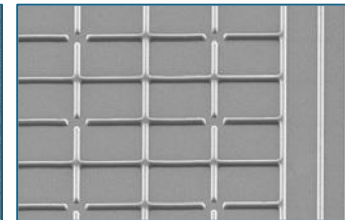
Turbinenrad 500 µm mit AR-N 4400-50



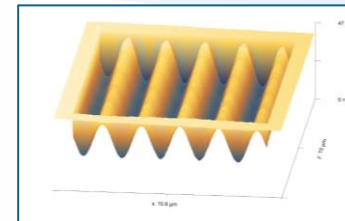
10 nm Gräben mit AR-P 6200.09



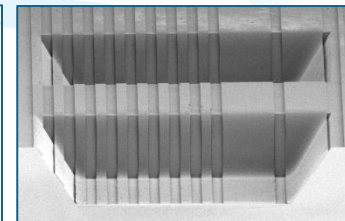
100 nm Strukturen mit Medusa 84



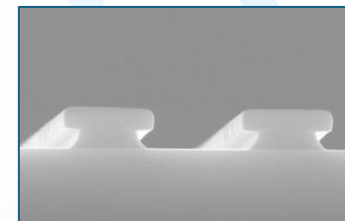
400 nm Stege mit AR-N 7520.073



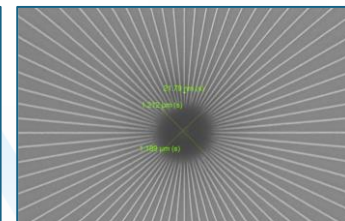
In Silizium geätzte Sinusstrukturen, mit Phoenix 81 mittels NanoFrazor



AR-N 2220 Resiststrukturen in 200 µm tiefen Ätzgruben



Thermostabiles 2-Lagen-Lift-off-System mit AR-BR 5460 & SX AR-N 4340/7



Medusa 84 Siemensstern auf Glas, prozessiert mit Electra 94



ALLRESIST entwickelt, produziert und vertreibt Resists für die Optische und Elektronenstrahl-Lithographie sowie die dazugehörigen Prozesschemikalien für die Herstellung von elektronischen Bauteilen.

- Breite Produktpalette - Resists für (nahezu) alle Standardtechnologien
- Prozessangepasste Resists nach Kundenwunsch für Industriekunden
- Entwicklung innovativer Produkte für neue Applikationen und Technologien mit gesundheitlich unbedenklichen und umweltfreundlichen Eigenschaften
- Ausgeprägte Industrieforschung, Projektbearbeitungen in Kooperation mit Forschungseinrichtungen und Unternehmen
- Individuelle kompetente Produkt- und Technologieberatung
- Kurze Lieferzeiten, vorrätige Produkte sofort lieferbar
- Kundenfreundliche Gebindegrößen ab 250 ml, Testmuster ab 100 ml



ALLRESIST kann aufgrund ihrer Kompetenz und Flexibilität spezielle Anwenderwünsche bereits bei der Konzeptionierung & Entwicklung neuer Resists berücksichtigen.

Wir bieten zusätzlich Verdüner, Entwickler, Stopper, Remover und Haftvermittler als optimal auf die Resists abgestimmte Prozesschemikalien an.

Ausführliche Produktinformationen mit Resist-Wiki, AR NEWS, FAQ und Sicherheitsdatenblättern finden Sie auf unserer Website unter [www.allresist.de](http://www.allresist.de).



ALLRESIST ist ein innovatives familiengeführtes Unternehmen und wurde 1992 von Brigitte und Matthias Schirmer gegründet. Ihre Tochter, Ulrike Schirmer, übernimmt nun den Staffelstab und möchte das Unternehmen mit den gleichen Grundwerten führen und weiterentwickeln.

**Qualität Innovation Kompetenz**

**Kreativität Nachhaltigkeit**

**Kundenorientierung Fairness**

**Soziale und ökologische Verantwortung**

#### Preise und Auszeichnungen:

- Ludwig-Erhard-Preis
- Qualitätspreis Berlin-Brandenburg
- Brandenburger Innovationspreis
- Deutschlands Kundenchampions
- Deutschlands Mitarbeiterchampions
- Exzellente Wissensorganisation
- Technologietransferpreis Brandenburg
- Zukunftspreis Ostbrandenburg
- Brigitte Schirmer - Zweitplatzierte Unternehmerin Brandenburgs
- Brigitte und Matthias Schirmer - Verdienstorden des Landes Brandenburgs



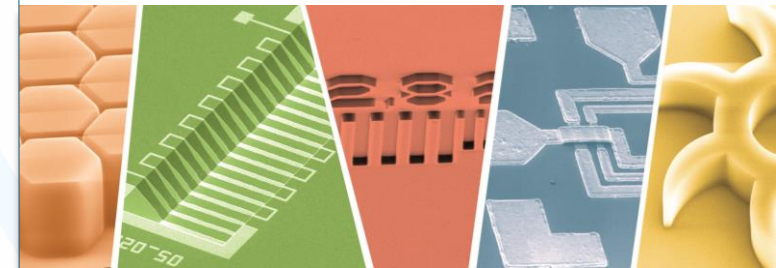
ISO 9001, ISO 14001

Zertifiziertes integriertes  
Managementsystem  
für Qualität und Umwelt

[www.tuev-sued.de/ms-zert](http://www.tuev-sued.de/ms-zert)



**ALLRESIST GmbH**  
Am Biotop 14  
15344 Strausberg  
Tel. 03341 / 35 93-0  
[info@allresist.de](mailto:info@allresist.de)  
[www.allresist.de](http://www.allresist.de)



**Ihr Spezialist für  
Resists und Prozesschemikalien  
seit über 30 Jahren**

